®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平3-9962

Sint. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

码公開 平成3年(1991)1月17日

67/50 C 09 B 47/04 G 03 G 5/06

Z 3 7 1

7433-4H 7537-4H 6906-2H

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全13頁)

図発明の名称

フタロシアニン結晶とその製造方法及びこれを用いた電子写真感光

体

頭 平1-144889 ②特

願 平1(1989)6月6日 四出

@発 明 奢 髙 明 者 何発

绞 正 和 蕤

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

Ξ 村 井 @発 明 者 松

直 Ż 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

智 久 個発 明 者 五 藤 夫 葉 ②発 明 者 薄

野

日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目33番1号

東京都品川区西五反田7丁目9番4号 東北加工株式会社

日本電気株式会社 勿出 願 人

東京都港区芝5丁目7番1号

弁理士 内原 70代 理 人

明細管

発明の名称 フタロシアニン結晶とその製造方法 およびこれを用いた電子写真感光体

特許請求の範囲

(1)無金属フタロシアニン窒素同構体、金属フタ ロシアニン窒素同構体、無金属フタロシアニン、 金属フタロシアニン、無金属ナフタロシアニンま たは金属ナフタロシアニン(ただし、無金属フタロ シアニン窒素同構体、金属フタロシアニン窒素同 構体、無金属フタロシアニンおよび金属フタロシ アニンはペンゼン核に置換基を有してもよく、ま た、無金属ナフタロシアニンおよび金属ナフタロ シアニンはナフチル核に置換基を有してもよい。) のうちの1種もしくは2種以上を全体で50重量部以 下と、チタニルフタロシアニンを100重量部含む組 成物結晶であり、その赤外吸収スペクトルにおい てその吸収波数(cm⁻¹)が、1490±2、1415±2、 1332 ± 2 , 1119 ± 2 , 1072 ± 2 , 1060 ± 2 , 961 ± 2 ,

893±2、780±2、751±2、730±2に特徴的な強い 吸収を有するフタロシアニン結晶。

- (2) CuKaを線源とするX線回折スペクトルにおい て、ブラッグ角(20±0.2度)が、27.3度に最大の回折 ピークを示し、9.7度、24.1度に強い回折ピークを 示す請求項(1)記載のフタロシアニン結晶。
- (3) CuKaを線源とするX線回折スペクトルにおい て、ブラッグ角(20±0.2度)が27.3度に最大の回折 ピークを示し、7.4度、22.3度、24.1度、25.3度、 28.5度に強い回折ピークを示す請求項(1)記載のフ タロシアニン結晶。
- (4) 無金属フタロシニン窒素同構体、金属フタロ シアニン窒素同構体、無金属フタロシアニン、金 属フタロシアニン、無金属ナフタロシアニンまた は金属ナフタロシアニン(ただし、無金属フタロシ アニン窒素同構体、金属フタロシアニン窒素同構 体、無金属フタロシアニンおよび金属フタロシア ニンはペンゼン核に置換基を有してもよく、ま . た、無金属ナフタロシアニンおよび金属ナフタロ シアニンはナフチル核に置換基を有してもよい。)

のうちの1種もしくは2種以上を全体で50重量部以下と、チタルフタロシアニンを100重量部含む非結晶製フタロシアニン組成物をテトラヒドロフランにて処理することを特徴とする、赤外吸収スペクトルにおいて波数(cm⁻¹)が1490±2、1415±2、1332±2、1119±2、1072±2、1060±2、961±2、893±2、780±2、751±2、730±2に特徴的な強い吸収を有するフタロシアニン結晶の製造方法。

(5) 導電層と感光層を備えた電子写真感光体において、該感光層中に電荷発生物質と電荷移動物質とを有し、この電荷発生物質として、無金属フタロシアニン窒素同構体、金属フタロシアニンは金属フタロシアニンはただし、無金属フタロシアニンを属フタロシアニンは 構体、金属フタロシアニンを属する 構体、金属フタロシアニンを 構体、金属フタロシアニンを は金属フタロシアニンを なが、金属フタロシアニンと が、金属フタロシアニンと が、金属フタロシアニンと が、金属フタロシアニンは が、金属フタロシアニンは が、また、無金属フタロシアニンは が、また、無金属フタロシアニンは が、また、無金属フタロシアニンは が、からに置換基を有してもよい。)のうちの1種もし

つあり、それらの要求に耐える感光体の開発が盛 んである。

特にレーザを光源とする場合、小型、安価、簡便さ等の点から、多くは半導体レーザーが用いられるが、現在これらに用いられる半導体レーザーの発振波長は、近赤外域の比較的長波長に限定されている。従って、従来電子写真法の複写機に用いられてきた可視領域に感度を有する、感光体を半導体レーザー用に用いるのは不適当であり、近赤外域に迄光感度を持つ感光体が必要となってきている。

この要求を満たす有機系材料としては従来、スクアリック酸メチン系色素、インドリン系色素、シアニン系色素ピリリウム系色素、ポリアゾ系色素、フタロシアニン系色素、ナフトキノン系色素等が知られているが、スクアリック酸メチン系色素、インドリン系色素、シアニン系色素ピリウム系色素は長波長化が可能であるが実用的安定性(くり返し特性)に欠け、ポリアゾ系色素は長波長化が

くは2種以上を全体で50重量部以下と、チタニルフタロシアニンを100重量部含む組成物結晶であり、その赤外吸収スペクトルにおいて、その吸収波数(cm⁻¹)が、1490±2、1415±2、1332±2、1119±2、1072±2、1060±2、961±2、893±2、780±2、751±2、730±2に特徴的な強い吸収を有するフタロシアニン結晶を含有することを特徴とする電子写真感光体。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は新規な結晶形を有するチタニルフタロシアニン組成物及びそれを用いた高感度な電子写真感光体に関する。

(従来の技術)

従来からフタロシアニン類金属フタロシアニン類は、優れた光導伝性を示すことが知られており、一部は、電子写真感光体に使用されている。近年、ノンインパクトプリンタ技術の発展に伴い、レーザ光やLEDを光源とする高画質高速化の可能な電子写真方式の光プリンタが広く普及しつ

難しく、かつ、製造面で不利であり、ナフトキノ ン系色素は感度的に離があるのが現状である。

これに対し、フタロシアニン系色素は、600nm 以上の長波長域に分光感度のピークがあり、かつ 感度も高く、中心金属や、結晶形の種類により、 分光感度が変化することから、半導体レーザー用 色素として適していると考えられ、精力的に研究 開発が行なわれている。

これまで検討が行なわれたフタロシアニン化合物の中で780nm以上の長波長域において高感度を示す化合物としては、x型無金属フタロシアニン、c型銅フタロシアニン、バナジルフタロシアニン等を挙げることが出来る。

一方、高盛度化のために、フタロシアニンの蒸 着膜を電荷発生層とする積層型感光体が検討され、周期律表III a族及びIV族の金属を中心金属とす るフタロシアニンのなかで、比較的高い感度を有 するものが幾つか得られている。このような金属 フタロシアニンに関する文献として、例えば特開 昭57-211149号、同57-148745号、同59-36254号、 同59-44054号、同59-30541号、同59-31965号、同59-166959号公報などがある。しかしながら、蒸着膜の作成には高真空排気装置を必要とし、設備費が高くなることから上記の如き有機感光体は高価格のものとならざるを得ない。

これに対し、フタロシアニンを蒸着膜としてではなく、樹脂分散層とし、これを電荷発生層として用いて、その上に電荷移動層を塗布して成る複合型感光体も検討され、このような複合型感光体としては無金属フタロシアニン(特願昭57-66963号)やインジウムフタロシアニン)特願昭59-220493号)を用いるものがありこれらは比較の長波を度域において急速に感度が低下する等の欠点を有し、又、後者は電荷発生層を樹脂分散系で作成する場合には実用化に対し感度が不充分である等の欠点を有している。

(発明が解決しようとする課題)

又、特に近年比較的高感度な電子写真特性を持 つチタニルフタロシアニンを用いるものについて

(課題を解決するための手段および作用)

本発明者らは上記欠点を改良し、かつ更に高感度な電荷発生剤として実用化できるチタニルフタロシアニンの組成物結晶変態挙動について鋭意検討した結果、きわめて溶剤安定性のある、分散性の良い、高い光電変換効率の新規結晶形の開発に成功し、本発明に至った。

すなわち、チタニルフタロシアニンに後述する ような他のフタロシアニン類あるいは、ナフタロ シアニン類化合物を添加し、同混合物の非結晶性 組成物をテトラヒドロフランにて処理結晶化され た新規な赤外吸収スペクトルを示す、優れた光導 電性を有するチタニルフタロシアニン組成物に関 する。

以下本発明を詳細に説明する。

本発明で用いられるフタロシアニン類化合物、 ナフタロシアニン類化合物は、モーザーおよび トーマスの「フタロシアニン化合物」(ラインホー ルド社1963)「フタロシアニン」(CRC出版1983)等 検討されており(特開昭59-49544号公報、同61-23928号公報、同61-109056号公報、同62-275272号。 公報)各種結晶形により特性に差異があることが知 られている。これらの各種結晶形を作成する為に は、特別な精製、特殊な溶剤処理を必要としてい る。その処理溶剤は、分散塗布膜形成時に用いら れるものとは異なっている。これは得られる各種 結晶が、成長処理溶剤中では、結晶成長し易く、 同溶剤を塗布用溶剤として用いると、結晶形、粒 径の制御が難しく、強料の安定性がなく、結果と して、静電特性が劣化し、実用上不適当であるか らである。その為通常は、塗料化の際には結晶成 長を促進し難いクロロホルム等の塩素系溶剤が用 いられる。しかしこれらの溶剤は、チタニルフタ ロシアニンに対して分散性が必ずしも良くなく、 塗料の分散安定性の面で問題である。

即ち、塗料化の際に用いる溶剤中で、結晶安定性があり、分散性の良い、更に光感度のすぐれたチタニルフタロシアニン結晶を提供することにある。

の公知方法および他の適当な方法によって得られ るものを使用する。

例えばチタニルフタロシアニンは、1,2-ジシア・ ノベンゼン(o-フタロジニトリル)またはその誘導体 と金属または金属化合物から公知の方法に従っ て、容易に合成することができる。

例えば、チタニウムオキシフタロシアニン類の 場合、下記(1)または(2)に示す反応式に従って容易 に合成することができる。

有機溶剤としては、ニトロベンゼン、キノリン、α-クロロナフタレン、β-クロロナフタレン、α-メチルナフタレン、メトキシナフタレン、ジフエニルエーテル、ジフエニルエ

タン、エチレングリコールジアルキルエーテル、 ジエチレングリコールジアルキルエーテル、トリ エチレングリコールジアルキルエーテル等の反応 に不活性な高沸点有機溶剤が好ましく、反応温度 は通常150℃~300℃、特に200℃~250℃が好まし

本発明においては、かくして得られる粗チタニルフタロシアニン化合物を非結晶化処理の後、テトラヒドロフランにて処理する。その際、予め適当な有機溶剤類、たとえば、メタノール、エタノール、インプロピルアルコール等のアルコール類、テトラヒドロフラン、1.4-ジオキサン等のエーテル類を用いて縮合反応に用いた有機溶剤を除去した後、熱水処理するのが好ましい。特に熱水処理後の洗液のpHが約5~7になるまで洗浄するのが好ましい。

引き続いて、2-エトキシエタノール、ジグライム、ジオキサン、テトラヒドロフラン、N,N-ジメ チルホルムアミド、N-メチルピロリドン、ピリジ

の(例えば米国特許第3973981号、同4088507号巻 照)、もしくは未知のものが挙げられる。各置換基 の導入法は公知のものは省略する。又、公知でな いものについては実施例中に参考例として記載す る。

本発明においてチタニルフタロシアニンとベンゼン核に置換基を有してもよいフタロシアニン窒素同構体もしくは無金属及び金属フタロシアニン・ナフチル核に置換基を有してもよい無金属及び金属ナフタロシアニンとの組成比率は100/50(重量比)以上であればよいが、望ましくは100/20~0.1(重量比)とする。この比以上では、結晶が混晶組成以外に単独結晶を多く含むようになり赤外吸収スペクトルや、X線回折スペクトルでの本発明の新規材料の識別が難しくなる。(以下これらの混合組成物についてチタニルフタロシアニン組成物と呼ぶ。)

非結晶性チタニルフタロシアニン組成物は単一 の化学的方法、機械的な方法でも得られるが、よ ン、モルホリン等の電子供与性の溶媒で処理する ことがさらに好ましい。

又、フタロシアニン窒素同様体としては、各種のポルフィン類、例えばフタロシアニンのベンゼン核の1つ以上をキノリン核に置き換えたテトラピリジノポルフィラジンなどがあり、また金属フタロシアニンとしては、銅、ニッケル、コバルト、亜鉛、錫、アルミニウム、チタンなどの各種のものを挙げることができる。

また、フタロシアニン類、ナフタロシアニン類 の置換基としては、アミノ基、ニトロ基、アルキル基、アルコキシ基、シアノ基、メルカプト基、ハロゲン原子などがあり、スルホン酸基、ボン酸基または、その金属塩なものとして例示する。 とができる。更にベンゼン核にアルンををといれる。 とができる。更にベンゼン核にアルンとどを比較的簡単なものとしてルンンできる。 とができる。 東にベンゼンをしていた。 とができる。 東にベンガンとしていた。 とができる。 東にベンガンとしていた。 とができる。 東にベンガンとしていた。 とができる。 東にベンガンとしていた。 とができる。 カルボニル基、イミノ基なかれる できる。 は来フタロシアニン顔料の技術的分野にな知のも 集防止剤あるいは結晶変換防止剤として公知のも

り好ましくは各種の方法の組合せによって得ることができる。

例えば、アシッドペースティング法、アシッド スラリー法、等の方法で粒子間の凝集を弱め、次 いで機械的処理方法で摩砕することにより非結晶 性粒子を得ることができる。摩砕時に使用される 装置としては、ニーダー、パンパリーミキサー、 アトライター、エッジランナーミル、ロールミ ル、ポールミル、サンドミル、SPEXミル、ホモミ キサー、ディスパーザー、アジター、ジョーク ラッシャー、スタンプルミル、カッターミル、マ イクロナイザー等があるが、これらに限られるも のではない。また、化学的処理方法として良く知 られたアシッドペースティング法は、95%以上の硫 酸に顔料を溶解もしくは硫酸塩にしたものを水ま たは氷水中に注ぎ再析出させる方法であるが、硫 酸および水を望ましくは5℃以下に保ち、硫酸を高 速撹拌された水中にゆっくりと注入することによ り、さらに条件良く非箱晶性粒子を得ることが出 来る。

その他、結晶性粒子を直接機械的処理できわめて長時間摩砕する方法、アシッドペースティング 法で得られた粒子を前記溶媒等で処理した後摩砕 する方法等がある。

非結晶性粒子は、昇擎によっても得られる。例 えば、真空下に於て各種方法で得られた原材科 各々500℃~600℃に加熱し昇率させ、基板上にすみ やかに共蒸着析出させることにより得ることがで きる。

上記の様にして得られた非結晶性チタニルフタロシアニン組成物をテトラヒドロフラン中にて処理を行い、新たな安定した結晶を得る。テトラヒドロフランの処理方法としては各種撹拌槽に非結晶性チタニルフタロシアニン組成物1重量部に対し5~300重量部のテトラヒドロフランを入れ撹拌を行う。温度は加熱、冷却いずれも可能であるが、加温すれば結晶成長が早くなり、又、低温では遅くなる。撹拌槽としては通常のスターラーの他、分散に使用される、超音波ボールミル、サンドミル、ホモミキサー、ディスパーザー、アジター、マイ

処理したチタニルフタロシアニンの赤外吸収スペクトル(第2図)も合わせて示す。これらの赤外吸収スペクトルから前記の方法で得られるチタニルフタロシアニン組成物が新規なものであることがわかる。

また、CuKa線を用いたX線回折図を第4~7図に示す。このチタニルフタロシアニン組成物は、X線回折図において、ブラック角28(但し±0.2度の誤差範囲を含むものとする。)が27.3度に最大の回折ピークを示し、9.7度、24.1度に強いピークを示す物と、27.3度に最大のピークを示し7.4度、22.3度、24.1度、25.3度、28.5度に強いピークを示す物とがある。これらの違いは一般に回折線の強度は、各結晶面の大きさにほぼ比例することから同一構造結晶の各結晶面の成長度合が異なる為とみなされる。

本発明のチタニルフタロシアニンは、テトラヒ ドロフラン中で更に加熱撹拌を加え、結晶成長の促 進を行っても赤外吸収スペクトルにおいて大きな クロナイザー等や、コンカルプレンダーV型混合機等の混合機等が適宜用いられるがこれらに限られるものではない。これらの撹拌工程の後、通常はろ過、洗浄、乾燥を行い、安定化したチタニルフタロシアニンの結晶を得る。この時ろ過、乾燥を行わず、分散液に必要に応じ樹脂等を添加し、 塗料化することもでき、電子写真感光体等の塗布膜として用いる場合、省工程となりきわめて有効である。

このようにして得られた本発明のチタニルフタロシアニン組成物赤外吸収スペクトルを第1図に示す。このチタニルフタロシアニンは、吸収波数(cm-1、但し士2の誤差を含むものとする。)が1490、1415、1332、1119、1072、1060、961、893、780、751、730の点に特徴的な強いピークを示すものである。Nメチルピロリドン処理をしたチタニルフタロシアニンの赤外吸収スペクトルと、アシッドペースト法[モザー・アンド・トーマス著「フタロシアニン化合物」(1963年発行)に記載されているα形フタロシアニンを得るための処理方法]により

変化を示さず、きわめて安定した良好な結晶である。

また、本発明の電子写真感光体は、導電性基板上に、アンダーコート層、電荷発生層、電荷移動層の順に積層されたものが望ましいが、アンダーコート層、電荷移動層、電荷発生層の順で積層剤にものや、アンダーコート層上に電荷発生剤のでも良い。又にできる。本発明によりではい系フタロシアニン化合物を電荷発生剤とである電荷発生層を得ることができる。

塗工は、スピンコーター、アプリケーター、スプレーコーター、パーコーター、浸漬コーター、ドクタープレード、ローラーコーター、カーテンコーター、ピードコーター装置を用いて行ない、乾燥は、望ましくは加熱乾燥で40~200℃、10分~6時間の範囲で静止または送風条件下で行なう。乾

燥後膜厚は0.01から5ミクロン、望ましくは0.1から 1ミクロンになるように塗工される。

電荷発生層を塗工によって形成する際に用いう るパインダーとしては広範な絶縁性樹脂から選択 でき、またポリ-N-ピニルカルパゾール、ポリピニ ルアントラセンやポリピニルピレンなどの有機光 導電性ポリマーから選択できる。好ましくは、ポ リビニルブチラール、ポリアリレート(ピスフェ ノールAとフタル酸の縮重合体など)、ポリカーポ ネート、ポリエステル、フエノキシ樹脂、ポリ酢 酸ピニル、アクリル樹脂、ポリアクリルアミド樹 脂、ポリアミド、ポリピニルピリジン、セルロー ス系樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、シリコ ン樹脂、ポリスチレン、ポリケトン、ポリ塩化ビ ニル、塩ビ-酸ビ共重合体、ポリビニルアセター ル、ポリアクリロニトリル、フェノール樹脂、メ ラミン樹脂、カゼイン、ポリビニルアルコール、 ポリピニルピロリドン等の絶縁性樹脂を挙げるこ とができる。電荷発生層中に含有する樹脂は、100 重量%以下、好ましくは40重量%以下が適してい

る。またこれらの樹脂は、1種または2種以上組合 せて用いても良い。これらの樹脂を溶解する溶剤 は樹脂の種類によって異なり、後述する電荷発生 層やアンダーコート層を塗工時に影響を与えない ものから選択することが好ましい。具体的にはベ ンゼン、キシレン、リグロイン、モノクロルベン ゼン、ジクロルベンゼンなどの芳香族炭化水素、 アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノ ンなどのケトン類、メタノール、エタノール、イ ソプロパノールなどのアルコール類、酢酸エチ ル、メチルセロソルブ、などのエステル類、四塩 化炭素、クロロホルム、ジクロルメタン、ジクロ ルエタン、トリクロルエチレンなどの脂肪族ハロ ゲン化炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキ サン、エチレングリコールモノメチルエーテルな どのエーテル類、N,N-ジメチルホルムアミド、N, N-シメチルアセトアミドなどのアミド類、および ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類が用 いられる。

電荷移動層は、電荷移動剤単体または結着剤樹脂に溶解分散させて形成される。電荷移動物質は公知のものいずれも用いることができる。電荷移動物質としては電子移動物質と正孔移動性物質があり、電子移動物質としては、クロルアニル、ブロモアニル、テトラシアノエチレン、テトラシアノエチレン、テトラシアノン、2,4,7-トリニトロ・9・ジシアノメチレンフルオレノン、2,4,7-トリニトロ・9・ジシアノメチレンフルオレノン、2,4,7-トリニトロ・9・ジシアノメチレンフルオレノン、2,4,7-トリニトロ・9・ジシアノメチレンフルオレノン、2,4,5,7-テトラニトロキサントン、2,4,8-トリニトコチオキサントン等の電子吸引性物質やこれら電子吸引物質を高分子化したもの等がある。

正孔移動物質としては、ピレン、N-エチルカル
パゾール、N-イソプロピルカルパゾール、N-メチ
ル-N-フエニルヒドラジノ-3-メチリデン-9-エチルカ
ルパゾール、N、N-ジフエニルヒドラジノ-3-メチ
リデン-9-エチルカルパゾール、N、N-ジフエニル
ヒドラジノ-3-エンチリデン-10-エチルフエノチアジ
ン、N、N-ジフエニルヒドラジノ-3-メチリデン-10エチルフエノキサジン、P-ジエチルアミノベンズア

ルデヒド-N、N-ジフエニルヒドラゾン、P-ジエチ ルアミノベンズアルデヒド-N-α-ナフチル-N-フエニ ルヒドラゾン、P-ピロリジノベンズアルアヒド-N、N-ジフエニルヒドラゾン、2-メチル-4-ジベンジ ルアミノ、ベンズアルデヒド-1'-エチル-1'-ベンゾチ アソリルヒドラソン、2-メチル-4-ジベンジルアミ ノベンズアルデビド-ユ゚ープロピル-ユ゚ーベンゾチアゾリ ルヒドラゾン、2-メチル-4-ジベンジルアミノベン ズアルデヒド-1'、1'-ジフエニルヒドラゾン、9-エチ ルカルバゾール-3-カルボキサルデヒド-1'-メチル-1'-フエニルヒドラゾン、1-ベンジル-1,2,3,4-テトラ ヒドロキノリン-6-カルボキシアルデヒド-1'、1'-ジ フエニルヒドラゾン、1,3;3-トリメチルインドレニ ン-ω-アルデヒド-N、N-ジフエニルヒドラゾン、P-ジエチルベンズアルデヒド-3-メチルベンズチアゾ リノン-2-ヒドラゾン等のヒドラゾン類、2,5-ビス (P-ジエチルアミノフエニル)-1,3,4-オキサジアゾー ル、1-フエニル-3-(P-ジエチルアミノスチリル)-5-(P-ジエチルアミノフエニル)ピラゾリン、1-(キノリ ル(2))-3-(P-ジエチルアミノスチリル)-5-(P-ジエチル アミノフエニル)ピラゾリン、1-(ピリジン(2))-3-(P-ジエチルアミノスチリル)-5-(P-ジエチルアミノフエ ニル)ピラゾリン、1-(6-メトキシ-ピリジル(2))-3-(P-ジエチルアミノスチリル)-5-(P-ジエチルアミノフエ ニル)ピラゾリン、1-(ピリジル(3))-3-(P-ジエチルア ミノスチリル)-5-(P-ジエチルアミノスフエニル)ピ ラゾリン、1-(レピジル(2))-3-(P-ジエチルアミノス チリル)-5-(P-ジエチルアミノフエニル)ピラゾリ ン、1-(ピリジル(2))-3-(P-ジエチルアミノスチリル)-4-メチル-5-(P-ジエチルアミノフエニル)ピラゾリ ン、1-(ピリジル(2))-3-(α-メチル-P-ジエチルアミノ スチリル)-5-(P-ジエチルアミノフエニル)ピラゾリ ン、1-フエニル-3-(P-ジエチルアミノスチリル)-4-メ チル-5-(P-ジエチルアミノフエニル)ピラゾリン、1-フエニル-3-(α-ペンジル-P-ジエチルアミノスチリ ル)-5-(P-ジエチルアミノフエニル)-6-ピラゾリン、 スピロピラゾリンなどのピラゾリン類、2-(P-ジエ チルアミノスチリル)-6-ジエチルアミノベンズオキ サゾール、2-(P-ジエチルアミノフエニル)-4-(P-ジエ チアミノフエニル)-5-(2-クロロフエニル)オキサゾー

ル等のオキサゾール系化合物、2-(P-ジエチルアミ ノスチリル)-6-ジエチルアミノベンソチゾール等の チアソール系化合物、ピス(4-ジエチルアミノ-2-メ チルフエニル0-フエニルメタン等のトリアリ-ルメ タン系化合物、1,1-ビス(4-N、N-ジエチルアミノ-2メチルフエニル)ヘプタン、1,1,2,2-テトラキス (4-N、N-ジメチルアミノ-2-メチルフエニル)エタン 等のポリアリールアルカン類、1,1-ジフエニル-P-ジフエニルアミノエチレン等のスチルベン系化合 物、4,4'-3メチルフエニルフエニルアミノピフエニ ル等のトリアリールアミノ系化合物、ポリ-N-ビニ ルカルハゾール、ポリビニルピレン、ポリビニル アントラセン、ポリピニルアクリジン、ポリ-9-ピ ニルフエニルアントラセン、ピレン-ホルムアルデ ヒド樹脂、エチルカルパゾールホルムアルデヒド 樹脂、ポリメチルフエニルシリレン等のポリシリ レン樹脂等がある。

これらの有機電荷移動物質の他に、セレン、セレン-テルルアモルファスシリコン、硫化カドミウムなどの無機材料も用いることができる。

また、これらの電荷移動物質は、1種または2種以上組合せて用いることができる。電荷移動層に用いられる樹脂は、シリコン樹脂、ケトン樹脂、アクリル樹脂ポリアリレート、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、アクリロニトリル・ブリカーボネート、ポリスチレン、ポリロニトリル・ブリコポリマー、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル・ボリマー、ポリスルホン、ポリアクリルアミド、塩素化ゴムなどの絶縁性樹脂、ポリーN-ビニルカルパゾール、ポリビニルアンなどが用いられる。

又、これら樹脂に通常用いられる各種添加剤、 例えば紫外線吸収剤や酸加防止剤等を適宜添加す ることは劣化防止に有効である。

並工方法は、スピンコーター、アプリケーター、スプレーコーター、パーコーター、浸漬コーター、ドクターブレード、ローラーコーター、カーテンコーター、ピードコーター等装置を用いて行ない、乾燥後膜厚は5から50ミクロン、

又、本発明の電子写真感光体は第8図の分光感度 特性図に示すように800nm近傍の波長に吸収ピー クがあり、電子写真感光体として複写機、プリン ターに用いられるだけでなく、太陽電池、光電変 換索子および光ディスク用吸収材料としても好適 である。

特開平3-9962 (8)

以下、本発明の実施例について説明する。例の 中で部とは、重量部を示す。

(合成例1)

o-フタロジニトリル20.4部、四塩化チタン7.6部をキノリン50部中で200℃にて2時間加熱反応後、水蒸気蒸留で溶媒を除き、2%塩酸水溶液、続いて2%水酸化ナトリウム水溶液で精製し、メタノール、N、N-ジメチルホルムアミドで洗浄後、乾燥し、チタニルフタロシアニン(TiOPc)21.3部を得た。

(合成例2)

アミノイミノイソインドレニン14.5部をキノリン50部中で200°Cにて2時間加熱し、反応後、水蒸気蒸留で溶媒を除き、2%塩酸水溶液、続いて2%水酸化ナトリウム水溶液で精製した後、メタノール、N,N-ジメチルホルムアミドで十分洗浄後、乾燥することによって、無金属フタロシアニン8.8部(収率70%)を得た。

(合成例3)

を形成してもよい。)で表されるフタロシアニン誘導体を得る。例えば、次式で表わされるフタロシアニン誘導体

$$\label{eq:mpc} \text{MPc (COCH}_2\text{N} \backslash \begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2 \backslash \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2 / \end{array} \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2 / \end{array}$$

を還元するには、ジエチレングリコール80部に水酸化カリウム6部を溶解し、これに上記フタロシアニン誘導体6部を十分細かく粉砕して加え、さらに抱水ヒドラジン10部を徐々に加え、約10時間還流する。得られた深青色スラリーを水に注ぎろ過、水洗、乾燥する。

表1に得られたフタロシアニン誘導体の例を示す。(ただし、MPcは各フタロシアニン残基を、またカッコ外の数字は分析による平均置換数を示す。MはH2, Cu, TiO, Zn等を示す)

(以下余白)

o-ナフタロジニトリル20部をキノリン50部中で200°Cにて4時間加熱反応後、2%塩酸水溶液で精製し、メタノール、N,N-ジメチルホルムアシドで洗浄後、乾燥し、無金属ナフタロシアニン15部を得た。

(合成例4)

無金属及び金属フタロシアニン15部、ジクロルトルエン500部、塩化アセチルクロライド25部および塩化アルミニウム70部の混合物を60~80°Cで8時間撹拌し、その後水中に投入し固形分をろ過、水洗、乾燥し、次式で示される化合物を得た。

MPc(COCH2Cl)1.3

これに、アミン類を公知の方法で反応させることにより、種々のフタロシアニン誘導体を得た。

これらの各種フタロシアニン誘導体を公知の方 法で還元することにより一般式

$$\text{MPc(CCH}_2\text{N} {\tiny \begin{array}{c} R_1 \\ R_2 \end{array}})_{1.3}$$

(式中 R_1 , R_2 は水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ基または窒素原子と R_1 , R_2 とでヘテロ環

表1

合成例番号	誘 導 体
4-a	CuPc-(-COCH2NHC2H5)1.1
4b	CuPc+CH ₂ N CH ₂ -CH ₂ CH ₂ 2.2
4-c	CuPc-(-CH2CH2NHCH3)1.6
4-d	CuPc+CH ₂ N CH ₂ -CH ₂ CH ₂) _{2,2}
4-e	CuPc+CH ₂ N CO)2.0

(合成例5)

常法によりクロルスルホン化した無金属フタロシアニン、銅フタロシアニン、ニッケルフタロシアニン、ナタニルフタロシアニンを各種アミンと反応させ表2に示されフタロシアニン誘導体を得た。

(以下余白)

鸽 導 体 合成例番号 SH SO2-NH 1.1 5-a SO2-NH-NH-TiOPc 5-b 302-NH-CH311.9 SH SO2-NH--Br I1 1 Pe -- SO2-NH-CH3 12.3 5-c SOaH las CuPc+SO3H)0.9 5-d (SO₂NH-(O))2.1 SO3NH4 3.5 CuPc +SO2NH -NiPe +SO2N - (H))1.7 5-f CoPc (-SO2NHC3H7)0.9 5-g

部およびポリカーポネート樹脂(三菱ガス化学Z-200)100部トルエン/THF(1/1)500部に溶解した溶液を乾燥膜厚が15µmとなる様に塗布し電荷移動層を形成した。

この様にして、積層型の感光層を有する電子写真感光体を得た。この感光体の半波露光量(E1/2)を静電複写紙試験装置(川口電機製作所EPA-8100)により測定した。即ち暗所で-5.5KVのコロナ放電により帯電させ次いで照度5luxの白色光で露光し、表面電位の半分に波衰するのに必要な露光量E1/2(lux, sec)を求めた。

(実施例2)

電荷移動物質に4-ジベンジルアミノ-2-メチルベンズアルデヒド、1,1'-ジフエニルヒドラゾンを用い、更に2-ヒドロキシ-4-メトキンベンゾフェノンを2部添加した以外実施例1と同様にし電子写真特性を測定した。

· (実施例3)

電荷移動物質に1-フェニル-1,2,3,4テトラヒドロキノリン6カルボキシアルデヒド1,1ジフェニルヒ

(寒施例1)

合成例1で得たチタニルフタロシアニン100部と前記合成例4で得られた表1に示す各誘導体各10部を、氷冷した98%硫酸に溶解し、水に沈殿させてろ過、水洗、乾燥することによって両者の均一な組成物を得る。この組成物10部をテトラヒドロフラン200部中で約5時間撹拌を行い、ろ過洗浄を行い乾燥後9.5部のチタニルフタロシアニン組成物結晶を得た。

この様にして得た物の赤外吸収スペクトルは第1 図の様な新しいものであった。又X線回折図は第5 図のようであった。この様にして得たチタニルフタロシアニン組成物0.4g、ポリビニルブチラール0.3g、THF30gと共にボールミルで分散した。この分散液をアルミニウム蒸着層を有するポリエステルフィルム上にフィルムアブリケーターで乾燥膜厚が0.2μmとなる様に塗布し、100°Cで1時間乾燥し、電荷発生層を得た。この様にして得られた電荷発生層の上に電荷移動剤としてジエチルアミノペンズアルデヒド-N,N-ジフエニルヒドラゾン100

ドラゾンを用いた以外実施例1と同様にし、評価した。

(実施例4)

実施例1と同様にして得た電荷発生層に精製したポリメチルフェニルシリレン50部をトルエン100部に溶解させ乾燥膜厚が12µmとなる様に塗布し電荷移動層を形成した。以下実施例1と同様に電子写真特性を測定した。

(実施例5)

合成例1で得たチタニルフタロシアニン1部と合成例2で得た無金属フタロシアニン0.05部とを5℃の98%硫酸30部の中に少しずつ溶解し、その混合物を約1時間、5℃以下の温度を保ちながら撹拌する。続いて硫酸溶液を高速撹拌した500部の氷水中に、ゆっくりと注入し、析出した結晶を建過する。結晶を酸が残量しなくなるまで蒸留水で洗浄し、ウエットケーキを得る。そのケーキ(含有フタロシアニン量1部と過程して)をテトラヒドロフラン100部中で約1時間撹拌を行い、ろ過、テトラヒドロフランによる洗浄を行い顔料含有分が0.95部であるチタ

ニルフタロシアニン組成物のテトラヒドロフラン 分散液を得た。一部乾燥させ、赤外吸収スペクト ルとX線回折像を調べた。結果第1図及び第6図と同 様であった。

次に本組成物が乾燥重量で1.5部、ブチラール樹脂(積水化学製BX-5)1部テトラヒドロフラン80部となる様に塗料を超音波分散機を用いて調製した。この分散液をポリアミド樹脂(東レ製CM-8000)を0.5μmコーティングしたアルミ板上に乾燥膜厚が0.2μmになるように塗布し電荷発生層を得た。その上に電荷移動剤として1,1,P-ジメチルアミノベンズ4,4ジフシニル2ブチレンを用い、更に2,4ビスn-(オクチルチオ)-6-(4ヒドロキシ3,5-ジ・レブチルアニリノ)-1,3,5-トリアジン2部を添加した以外は実施例1と同様にして電子写真感光体を作成し、測定した。

(実施例6)

実施例5の無金属フタロシアニンの代わりに合成 例3で得た無金属ナフタロシアニンを0.05部用いた 他は、実施例5と同様に試料を作成し、赤外吸収ス

びX線回折像は第1図及び第4図のようであった。以 下感光体を実施例1と同様に作成し測定評価した。

表 3

実施例番号	誘導体		
8-a	Pc + Cl) 4.0		
8-b	Pc-(Br) 12.1		

ただし、表3中Pcは無金属フタロシアニン残基を示す。

(実施例9)

実施例8の塩素化無金属フタロシアニン1部の代わりに各々合成例5-a,5-b,5-d,5-f,5-g各5部を用いた以外は実施例1と同様にして感光体を作成し測定した。

(実施例10)

実施例1で得られたチタニルフタロシアニン1部とp-ジエチルアミノベンズアルデヒド-1,1ジフエニルヒドラゾン0.7部、ポリエステル樹脂(バイロン200東洋紡製)をテトロヒドロフラン、トルエン(1/1) 混合液に溶解した溶液42部をガラスピーズと共に

ベクトルが第1図と同様であることを確認し、次い で感光体にして測定した。

(実施例7)

鋼テトラピリジノポルフィラジンを公知の方法 によって合成した。

チタニルフタロシアニン100部と上記網テトラビリジノポルフィラジン10部とを漫硫酸に溶解し水中に投入、ろ過、水洗、乾燥して均一で微細な結晶を得た。さらに実施例5同様にテトラヒドロフランで洗浄した結果、赤外吸収スペクトル、及びX線回折像は第1図及び第7図のようであった。以下感光体を実施例1と同様に作成し、測定評価した。(実施例8)

常法により表3のフタロシアニン誘導体8-a及び8-bを合成した。チタニルフタロシアニン100部と上記塩素化無金属フタロシアニン1部とを濃硫酸に溶解し、水中に投入、ろ過、水洗、乾燥して均一で微細な結晶を得た。これを実施例5同様にテトラヒドロフランで洗浄した結果赤外吸収スペクトル及

ガラス容器にてペイントコンディショナーで分散 した後、乾燥膜厚が12μmとなる様にアルミ板上に 途布し、単層型電子写真感光体を作成した。帯電 印加電圧を+5.5KVとした以外は実施例1と同様に 測定し特性を評価した。

(比較例1,2)

合成例1で得られる硫酸処理前のオキシチタニウムフタロシアニンをNメチルピロリドンにて洗浄処理を行い赤外吸収スペクトルで第3図に見られる結晶を得た(比較例1)。

又、硫酸処理直後に得られる非結晶性フタロシアニンの赤外吸収スペクトル第2図の様であった(比較例2)。

これらを用いてそれぞれ分散溶媒をジクロルメタン、トリクロルエタン混合液(1/1)に変更した以外は実施例1と同様にして感光体を作成し、評価した。

以上示した実施例1~10および比較例2の初期表面電位、2秒後暗波衰率、半減露光量、光照射5秒 後表面電位をまとめて表4に示す。

表 4

	V₀(V)	V ₂ /V ₀ (%)	E}(lux·s)	V _R (V)
実施例1-a	-718	89	0.6	-8
1-b	-695	90	0.9	-12
1-c	-688	88	0.5	-6
1-d	-697	89	0.9	-15
1-e	-709	90	0.7	-9
2	-685	88	0.7	_7
3	-712	. 89	6.8	-11
4	_725	92	0.9	-21
5	-748	92	0.7	-18
6	-729	91	0.7	-15
7	-692	88	0.6	-5
8-а	695	89	0.4	-4
8-b	-678	88	0.4	-3
9-a	-695	87	0.5	-5
9-Ь	-677	86	0.4	-3
5-e	-690	87	0.5	-5
9-f	-683	86	0.4	-4
9-g	-672	86 -	0.4	-4
10	+655	92	1.0	+17
比较例1	-580	85	1.3	-22
2	-650	. 90	1.2	-20

同品のX線回折図、第8図は実施例により得た本発 明の電子写真感光体の分光感度特性図を示す。

代理人 弁理士 内原 晋

Vo 初期表面電位

 V2
 2秒後表面電位

 V2/Vo
 2秒後暗減衰率

 E1
 半減露光量

V_R 光照射5秒後表面電位

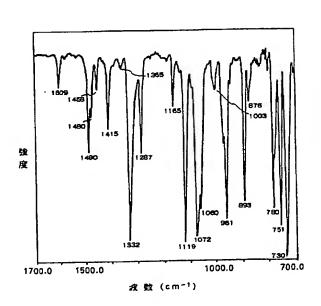
(発明の効果)

以上のように本発明の材料は、新規な安定な結晶体であり、溶剤に対し安定な為、塗料とする場合、溶剤選択が容易になり、分散の良好な、寿命の長い塗料が得られるので、感光体製造上重要な、均質な製膜が容易となる。得られた電子写真感光体は、特に半導体レーザ波長域に対して高い光感度を有し、特に高速・高品位のブリンタ用感光体として有効である。

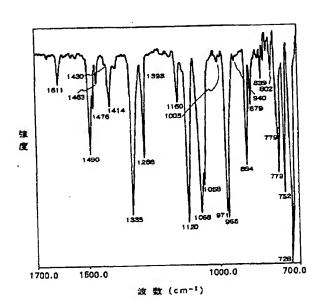
図面の簡単な説明

第1図は本発明によるチタニルフタロシアニン組成物の赤外吸収スペクトル図、第2図、第3図はそれぞれ比較例2,1により得られた公知のチタニルフタロシアニンの赤外吸収スペクトル図、第4~7図は

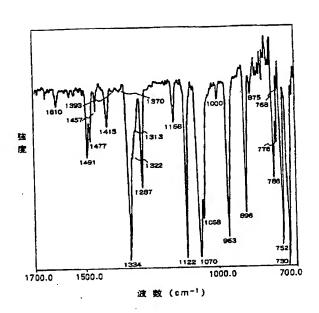
第 1 図

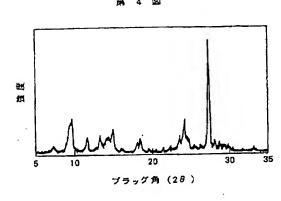


蘇 2 図

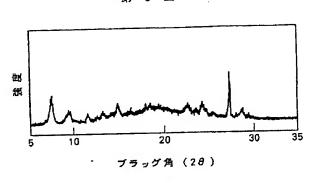


第 3 図

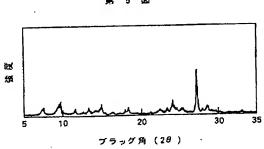




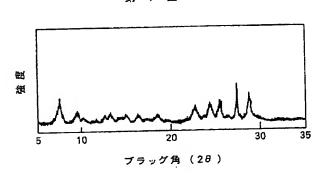
ear 6 12



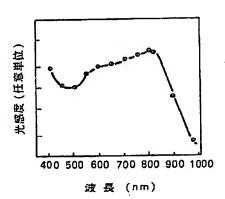
ear e (C7)



第 7 図



第 8 図



This Page Blank (uspto)